

2018年3月26日

高純度臭化水素 生産能力増強を完了

昭和電工株式会社(社長:森川 宏平)は、半導体製造工程で使用される高純度臭化水素(HBr)の生産設備増強工事を完了し、今月より生産を開始しました。

高純度 HBr は DRAM や NAND 型フラッシュメモリ等の半導体製造工程において、ポリシリコンの微細加工(エッチング)に使用される特殊ガスです。IoT、ビッグデータ、自動運転といったデジタルイゼーションの加速化で半導体市場はますます拡大し、それに合わせ高純度 HBr の需要も拡大しております。

当社は、川崎事業所にて年産 600 トンの合成・精製生産設備を有しておりますが、高稼働が継続していることから、さらなる需要増を見込み、今般、年産能力を 1.5 倍の 900 トンに増強しました。

当社の電子材料用高純度ガス事業は 40 年近い歴史を持ち、長年培ってきた精製・分析・品質管理技術において高い評価をいただいています。また当社はフッ素系・塩素系・臭素系・アンモニア系といった多様な高純度ガスを製造・販売する世界唯一の企業として、お客様の製造工程に最適なガスを提案いたします。

当社は、現在推進中の中期経営計画“Project 2020+”において、電子材料用高純度ガスを成長加速事業に位置づけております。当社は今後も、拡大する世界の電子材料市場に迅速に対応し、同事業の強化・拡大を図ってまいります。

以上

